

國立彰化師範大學共同儀器中心 反應式離子蝕刻機對外服務辦法

一、儀器名稱：

中文名稱：反應式離子蝕刻機

英文名稱：Reactive Ion Etcher (RIE)

二、儀器廠牌、型號：

乙先 RIE-500

三、儀器簡介：

反應式離子蝕刻機是利用射頻電源產生電漿進行蝕刻，搭配不同氣體選擇，可以有效達到對不同材料的蝕刻，本儀器有提供 O₂、CF₄。



四、儀器設備重要規格：

1. Max. source power : 400W
2. Process gas (max. sccm) : CF₄(100),N₂(100),O₂(100)
3. Substrate size : 4inch wafer

五、放置地點：

進德校區藝薈館 B1F：奈米科技中心

六、儀器相關人員：

儀器負責教授	洪連輝 教授	(04) 7232105 ext. 3324
儀器管理人	賴高範 先生	(04) 7232105 ext. 3340

七、機台使用辦法：

本機台之使用為委託操作方式。由本中心指派合格人員代為操作儀器。

八、服務時間：

1. 本系統服務以二小時為一時段，最少預約 1 時段，每週開放 4 時段受理委託操作申請，操作時段為週五：上午 08:00~12:00；下午 13:00~17:00，其餘時段僅供本中心設備維護、人員訓練或計畫執行之用。
2. 對外開放時段，若因設備維護或技術訓練等事宜，得暫停開放。
3. 詳細開放時間逕洽儀器管理人。

九、申請辦法與規定事項：

1. 申請服務最遲須於一周提出，否則不予受理。
2. 申請人下載並填妥「奈米核心設施委託操作申請表」後，先行與儀器管理人接洽委託操作事宜後，再行線上進行預約動作，經儀器管理者確認後即完成預約。
3. 取消預約最遲須於前 3 日提出，否則仍應按申請時段繳交費用。
4. 儀器操作人得視需要，要求申請人在現場共同進行實驗。

十、其他相關規定及懲處：

1. 預約使用必須為本人到場，若有責任歸屬視以該時段預約者之責任。
2. 為避免影響他人使用權益，預約未到者，需按申請時段付繳交費用。如臨時無法前來，請務必取消預約。
3. 預約未到累積 2 次以上，將處以 1 個月停權處分，以維護其他使用者的權益。
4. 未經許可私自帶走本實驗室任何物品者，提報指導教授與實驗室負責人另議懲處。

十一、收費標準：

項目	校外學術單位	產業界
費用	2,000 元	3,000 元
備註	1. 操作以兩小時作為計費單位。 2. 不足兩小時者，仍以兩小時計費。 3. 第三小時起，每一小時作為計費單位。 4. 收費時間以實際時間收費。 5. 核心設施成員不收費，校內老師與計畫合作老師使用費用對折優惠。	